日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filled ith this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月31日

出願番号 pplication Number:

特願2003-093993

ST. 10/C]:

[J P 2 0 0 3 - 0 9 3 9 9 3]

願 人 plicant(s):

クロリンエンジニアズ株式会社 三井化学株式会社 東亞合成株式会社 鐘淵化学工業株式会社 東リー株式会社 東リー株式会社 旭化成ケミカルズ株式会社 がインー株式会社 株式会社

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 3月30日





【書類名】

特許願

【整理番号】

CE386

【提出日】

平成15年 3月31日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

C25B 11/00

【発明者】

【住所又は居所】

岡山県玉野市東高崎24-6 クロリンエンジニアズ株

式会社 岡山事業所内

【氏名】

片山 眞二

【発明者】

【住所又は居所】

岡山県玉野市東高崎24-6 クロリンエンジニアズ株

式会社 岡山事業所内

【氏名】

浅海 清人

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市川崎区京町2-24-7-604

【氏名】

相川 洋明

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市港区昭和町17-23 東亞合成株式会

社内

【氏名】

刑部 次功

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市港区昭和町17-23 東亞合成株式会

社内

【氏名】

浜守 光晴

【特許出願人】

【識別番号】

000105040

【氏名又は名称】

クロリンエンジニアズ株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 500509391

【氏名又は名称】 社団法人 新化学発展協会

【代理人】

【識別番号】 100091971

【弁理士】

【氏名又は名称】 米澤 明

【選任した代理人】

【識別番号】 100088041

【弁理士】

【氏名又は名称】 阿部 龍吉

【選任した代理人】

【識別番号】 100092495

【弁理士】

【氏名又は名称】 蛭川 昌信

【選任した代理人】

【識別番号】 100092509

【弁理士】

【氏名又は名称】 白井 博樹

【選任した代理人】

【識別番号】 100095120

【弁理士】

【氏名又は名称】 内田 亘彦

【選任した代理人】

【識別番号】 100095980

【弁理士】

【氏名又は名称】 菅井 英雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100094787

【弁理士】

【氏名又は名称】 青木 健二

【選任した代理人】

【識別番号】 100097777

【弁理士】

【氏名又は名称】 韮澤 弘

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014845

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9712326

【包括委任状番号】 0103239

【その他】 国等の委託研究の成果に係る特許出願(平成13年度新

エネルギー―産業技術総合開発機構「エネルギー使用合

理化ガス拡散電極食塩電解技術開発」委託研究、産業活

力再生特別措置法第30条の適用を受けるもの)

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ガス拡散電極を有する電解槽

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガス拡散電極を有する電解槽において、ガス拡散電極の対極側に対向する電極面の周囲が枠状部材に形成された接合枠部と気密に接合され、該枠状部材の少なくとも接合枠部のガス拡散電極との接合面には、パーフルオロスルホン酸層、パーフルオロスルホニルフルオリド層、あるいはパーフルオロカルボン酸アルキルエステル層を有するとともに、該枠状部材の周辺部はガスケットを介して積層されたことを特徴とするガス拡散電極を有する電解槽。

【請求項2】 枠状部材には、複数個の接合枠部が形成され、それぞれの接合枠部にガス拡散電極が接合されたことを特徴とする請求項1記載のガス拡散電極を有する電解槽。

【請求項3】 枠状部材が接合された部分のない部材で一体に形成されたものであることを特徴とする請求項1または2記載のガス拡散電極を有する電解槽

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ガス拡散電極を有する電解槽に関するものであり、特に電極面積が大きなガス拡散電極を有する電解槽に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

水溶液中での電気分解では、陰極では一般に水素過電圧の関係から水素発生反応が起こる。電気分解で生成する水素は他の手段によって得られるものに比べて高純度であるものの、水素の取得を目的とする場合以外には、水素発生を避けて電気分解電圧を低下させ、電気分解反応における電力原単位を減少させることが提案されている。

すなわち、陰極として一般的な水素発生電極に代えて酸素ガス拡散電極を用いた場合には、陰極においては水素は発生せず、理論的には水の電気分解電圧に相

当する1.2 Vの電気分解電圧の低下が可能である。したがって、ガス拡散電極を用いた場合には電気分解に要する電気エネルギーを減少させることができるので、酸素ガス拡散電極を陰極とした電気分解方法は、水素の高度な利用条件のない工場においては極めて有効な電気分解方法である。

[0003]

そこで、陰極での水素の生成を防止し、電気分解電圧を低下するために、陰極 に酸素ガス拡散電極を配置して酸素を供給する電気分解方法が提案されている。

ガス拡散電極は、反応層部において、気体、液体、および固体の三相界面を形成するために、フッ素樹脂等の撥水性を有する合成樹脂と、触媒、導電性物質等を含有する組成物を成形したものを用いたり、あるいはさらに成形したものを焼結することによって製造されている。

$[0\ 0\ 0\ 4]$

一方、食塩水のイオン交換膜電解槽に代表される工業用の水溶液電解槽は、大型化が進んでおり、数平方メートルの電極面積を有する大型の電解槽が用いられている。

このような大型の電解槽にガス拡散電極を装着する場合には、面積が大きなガス拡散電極が必要となるが、大面積のガス拡散電極を製造することは容易ではない。また、ガス拡散電極は、フッ素樹脂、導電性物質等の組成物から形成されているので機械的強度が小さく、大面積となると自重の為に変形したり、あるいは取り扱いも難しくなる。

[0005]

そこで、電極面積が大きな電解槽を作製するためには、面積が小さな多数のガス拡散電極を配置することが必要となり、多数のガス拡散電極を電解液や気体が漏洩しないように接合して配置することが必要となる。

このような目的で、開口部を2箇所以上有する耐食性金属枠の開口部に銀板を 介してガス拡散電極をホットプレスによって接合したガス拡散電極を有する電解 槽が提案されている(例えば、特許文献1)。

しかしながら、ガス拡散電極にホットプレスする方法では、金属板とフッ素樹脂を含有したガス拡散電極との接合部における接合特性は充分ではなかった。

[0006]

【特許文献1】

特開2000-239881号公報

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、電極面積が大きな電解槽を提供することを課題とするものであり、 電解槽を組み立てた際に漏洩等のおそれが無く、電解面に複数個のガス拡散電極 を取り付けた電極面積が大きな電解槽を提供することを課題とするものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明の課題は、ガス拡散電極を有する電解槽において、ガス拡散電極の対極側に対向する電極面の周囲が枠状部材に形成された接合枠部と気密に接合され、該枠状部材の少なくとも接合枠部のガス拡散電極との接合面には、パーフルオロスルホン酸層、パーフルオロスルホニルフルオリド層、あるいはパーフルオロカルボン酸アルキルエステル層を有するするとともに、該枠状部材の周辺部はガスケットを介して積層されたガス拡散電極を有する電解槽によって解決することができる。

一般にフッ素樹脂、カーボンブラック等の導電性物質等から形成されたガス拡 散電極は、他の物質との接合性が好ましくないが、本発明のように、少なくとも 一方の面にパーフルオロスルホン酸層、パーフルオロスルホニルフルオリド層、 あるいはパーフルオロカルボン酸アルキルエステル層を有する枠状部材からなる 接合枠部に電極面の周囲を接合することによって接合枠部とガス拡散電極との接 合部を漏洩がない特性が優れたものとすることができる。また、ガス拡散電極を 設けた接合枠部は合成樹脂製材料で形成されているので、ガスケットを介して積 層して電解槽を組み立てた場合にはガスケットとの密着性が良好となり、積層部 からの漏洩がない電解槽を作製することができる。

[0009]

また、枠状部材には、複数個の接合枠部が形成され、それぞれの接合枠部にガス拡散電極が接合された前記のガス拡散電極を有する電解槽である。

このように枠状部材には複数個の接合枠部を形成することにより、製造、取り扱い等において問題がある電極面積が大きなガス拡散電極に代えて、比較的、製造、あるいは取り扱いが容易な面積が小さな単位ガス拡散電極の複数個を製造し、各接合枠部に取り付けることによって、任意の面積のガス拡散電極を有する電解槽を提供することが可能となる。

したがって、既に稼働中のガス拡散電極を使用していない電解槽を多数配置した電解槽回路の一部の電解槽の陰極をガス拡散電極に交換して同様に運転することができる。

[0010]

また、枠状部材が接合部のない部材で一体に形成されたものである前記のガス 拡散電極を有する電解槽である。

このように、枠状部材が接合部のない部材で一体に形成された場合には、接合に伴う凹凸等もなく、電解槽を組み立てた際には密封特性に優れた電解槽を形成することができる。

[0011]

【発明の実施の形態】

本発明は、フッ素樹脂を含有した組成物から形成されたガス拡散電極の電極面に、枠状部材に設けたパーフルオロスルホン酸層、パーフルオロスルホニルフルオリド層、あるいはパーフルオロカルボン酸アルキルエステル層からなる接合枠部を面して加熱融着することによって、強度の大きく、流体に対する封口特性に優れた接合部を形成することが可能となる。また、枠状部材に複数個の接合枠部を設けて各接合枠部にガス拡散電極を配置して接合することによって、電極面積が大きなガス拡散電極を有する電解槽が作製可能であることを見出したものである。

$[0\ 0\ 1\ 2\]$

以下に図面を参照して本発明を説明する。

図1は、ガス拡散電極を有するイオン交換膜電解槽の一実施例を説明する図であり、食塩水の電解槽を説明する図である。

イオン交換膜電解槽1は、陽イオン交換膜2によって陽極室3と陰極室4に区

画されており、陽極室3には、陽極5が配置されている。

陽極 5 は、チタン等の薄膜形成性金属からなるエキスパンデッドメタル等の多 孔性支持体上に白金族の金属、金属酸化物を含有する電極触媒被覆を形成した電 極を用いることができる。また、陰極室 4 には、陰極液室 4 a が形成され、ガス 拡散電極 6 が配置されている。

[0013]

ガス拡散電極6は、ステンレス、ニッケル、銀などの耐食性材料から成る金網、エキスパンデッドメタル、粉末焼結体、金属繊維焼結体、発泡体等の材料を陰極集電体とし、このような集電体に電極触媒を含有した反応層およびガス拡散層を積層してガス拡散電極を形成することができる。

電極触媒としては、白金、パラジウム、ルテニウム、イリジウム、銀、コバルト等の金属又はそれらの酸化物を使用できる。これらの電極触媒は、フッ化黒鉛、フッ素樹脂等の疎水性材料とを混練して塗布する等の方法によって形成することができる。

またガス拡散電極6の背面、すなわち陽イオン交換膜2とは反対側の面には、 多孔性の陰極支持体7が設けられており、ガス室8を形成している。

$[0\ 0\ 1\ 4\]$

陽極室3には、下部に設けた陽極液供給口10から食塩水が陽極液として陽極室内に供給され、陽極において電気分解を受けた後に、濃度が低下した食塩水は、陽極で発生した塩素とともに上部に設けた陽極液流出口11から排出される。

また、陰極室4のガス室8には、上部に設けた酸素含有気体供給口12から酸素含有気体が供給され、陰極液室4aの下部に設けた陰極液供給口13から希薄な水酸化ナトリウム水溶液が供給される。そして、ガス拡散電極6において酸素、水、電子との反応によって生じた水酸化物イオンと、イオン交換膜を透過して陰極液室へ到達したナトリウムイオンから水酸化ナトリウムが生成して、上部の陰極液流出口14から取り出される。また、酸素含有気体排出口15からは酸素含有量が低下した気体が排出される。

[0015]

図2は、本発明のガス拡散電極を有する電解槽の陰極室をガス拡散電極の反応

層側からみた平面図である。

図 2 (A) は、平面図を示し、図 2 (B) は、図 2 (A) を A -A $^{\prime}$ 線で切断した断面を拡大して説明する図である。

陰極室4には、4個の単位ガス拡散電極6a,6b,6cおよび6dが陰極支持体7を介して、陰極室隔壁21に取り付けられている。

[0016]

単位ガス拡散電極 6 a, 6 b, 6 c および 6 d のそれぞれの周囲は、パーフルオロスルホン酸樹脂膜から形成された、ガス拡散電極の電極面よりも小さな接合枠部 2 3 を形成した枠状部材 2 4 が熱融着されており、ガス拡散電極の固定と、ガス拡散電極と枠状部材 2 4 との間の空間からの電解液、あるいは気体の漏洩が防止されている。

また、枠状部材24の周囲の両面には、ガスケット25が配置されて、陰極室隔壁21のフランジ面26、および積層されるイオン交換膜あるいは対極側との部材と密封して積層することができる。

[0017]

図3は、本発明の枠状部材について説明する図であり、図3(A)は斜視図であり、図3(B)ないし(D)はそれぞれ、図3(A)におけるA-A、線での断面を図3(A)とは異なる縮尺で示す図である。

図3(A)に示した枠状部材24は、3個の接合枠部23から形成されている

枠状部材24としては、図3(B)に示すようにすべてがパーフルオロスルホン酸層30で形成されたものを使用することができる。

また、図3 (C) は、パーフルオロスルホン酸層30からなる枠状部材24の 内部に補強布31を有するものである。これによって枠状部材の強度が大きく、 また枠状部材の形状安定性にも優れているものを得ることができる。その結果、 ガス拡散電極との接合部の強度が大きく、枠状部材の周囲の積層面での積層状態 が安定した電解槽を形成することができる。

[0018]

枠状部材の作製は、面積が大きなシート状の部材を所定の大きさに切断した後

に、ガス拡散電極を配置する接合枠部を切断あるいはうち抜きによって形成した 接合された部分がない一体に形成されたものが好ましい。しかしながら、帯状の 部材を所定の形状に接合して作製したものであっても良い。

また、接合枠部のみにパーフルオロスルホン酸層を有する部材として、その他 の部分はパーフルオロスルホン酸層を有さない部材で形成しても良い。

また、枠状部材の周辺部は、周囲に配置するガスケットとを一体に形成しても 良い。

また、少なくとも一方の面にパーフルオロスルホン酸層を有する部材としては、パーフルオロスルホン酸系のイオン交換膜を挙げることができ、具体的にはナフィオン324 (デュポン社製)を挙げることができる。

[0019]

また、パーフルオロスルホン酸膜としてイオン交換膜を使用する場合には、イオン交換容量が大きな面を被接合部に面して接合させることが好ましい。

また、パーフルオロスルホン酸膜がナトリウム等の金属イオンと結合して、ナトリウム型等のイオン交換基を有する場合には、充分な接合特性を得ることはできないので塩酸等の酸によって処理して酸型とした後に使用することが好ましい

また、パーフルオロスルホン酸膜としては、既に食塩電解槽に装着された使用 済みイオン交換膜を用いることができる。この場合には、使用済みイオン交換膜 を塩酸等の酸で処理して、ナトリウム基を酸型に変換するとともにイオン交換膜 面あるいはその内部に含まれる各種の物質を溶出して除去することが好ましい。 また、酸による処理と併用してキレート化剤によって処理を行って金属化合物を 除去しても良い。

[0020]

また、パーフルオロスルホニルフルオリド層、パーフルオロカルボン酸アルキルエステル層を有する部材としては、イオン交換基の導入処理をしていない前駆体として提供されているフレミオン854 (旭硝子社製)を挙げることができる。この前駆体では、一方の面にパーフルオロスルホニルフルオリド層を有し、他方の面にパーフルオロカルボン酸アルキルエステル層を有している。

[0021]

本発明のガス拡散電極を有する電解槽は、複数個のガス拡散電極を所定の間隔で配置し、パーフルオロスルホン酸層、パーフルオロスルホニルフルオリド層、パーフルオロカルボン酸アルキルエステル層を有する膜を配置した後に、膜の溶融温度以上の温度に熱融着手段を加熱するとともに加圧して融着することができる。また、加熱融着の後には速やかに冷却することによって周囲へ悪影響を及ぼすことなく強度が大きな接合部を形成することが可能となる。

一例を挙げれば、加熱温度270ないし280℃、圧力2MPaの条件で加圧 した後に、80℃まで急冷することによって接合することができる。

[0022]

以下に、実施例を示し本発明を説明する。

実施例1

(ガス拡散電極の作製)

ガス拡散電極は、ガス供給層と反応層を積層して作製した。

(イ) ガス供給層用原料の調製

界面活性剤水溶液(水 9 0 L、 2 0 質量%(トライトンX - 1 0 0)水溶液 1 2.5 L)に、疎水性カーボンブラック(電気化学工業製 AB-6 平均粒径 5 0 n m) 5 k gを分散し、次いでポリテトラフルオロエチレンディスパージョン3.7 2 L(固形分 3.3 5 k g)を分散、混合した後に、エタノール 7 6 k gを添加して、ポリテトラフルオロエチレンディスパージョンのミセルを破壊することによって凝集した。

次いで、濾過、脱水、乾燥した後に、ペレット状の8.2kgの成形用原料を作製した。

[0023]

(ロ)反応層用原料の調製

界面活性剤水溶液(水 9 0 L、 2 0 質量%(トライトンX-1 0 0)水溶液 1 2.5 L)に、疎水性カーボンブラック(電気化学工業製 A B-6) 0.85 kg、親水性カーボンブラック(電気化学工業製 A B-1 2) 2 kgを分散し、次いで、銀微粒子(平均粒径 0.3 μm) 1 kgを添加して分散した後に、

ポリテトラフルオロエチレンディスパージョン1.57L(固形分1.42kg)を分散、混合した後に、エタノール72kgを添加して、ポリテトラフルオロエチレンディスパージョンのミセルを破壊することによって凝集した。

次いで、濾過、脱水、乾燥した後に、ペレット状の 5.5 kgの成形用原料を作製した。

[0024]

(ハ) 成形工程

得られたガス供給層原料を粉砕して、水を加えて混練してスラリーを調製し、 銀からなるエキスパンデッドメタル(SW1mm、LW2mm、ST0.18mm、厚さ0.3mm)に塗布し、更にその上に反応層用原料を粉砕して、エタノールを加えて混練して製造したスラリーを塗布、乾燥した後に、エタノールで界面活性剤を抽出除去した。

その後、乾燥の後に温度360℃、圧力4.9MPaの条件で60秒間加圧融着して厚さ1mmのガス拡散電極を得た。

得られたガス拡散電極から、縦80mm、横35mmのガス拡散電極を切断した。

$[0\ 0.2\ 5]$

(接合工程)

パーフルオロスルホン酸からなる大きさ96 mm×96 mmの陽イオン交換膜(ナフィオン324)の中央部に10 mmの間隔を設けて縦56 mm、横25 mmの2個の開口部を形成した。

陰極隔壁に所定の箇所に陰極支持体およびガス拡散電極を配置し、ガス拡散電極を各接合枠部に位置するように枠状部材を配置し、パーフルオロスルホン酸膜面に設けた開口部にガス拡散電極が配置して、加熱接合装置によってガス拡散電極の周辺部のパーフルオロスルホン酸膜を、順次2MPaの圧力で280℃の温度で60秒間加熱溶融して接合した。

ガス拡散電極を配置した枠状部材を25 \mathbb{C} の条件で、反応層側から水を注入して、30 k M P a (ゲージ圧)まで加圧したが水漏れは生じなかった。

[0026]

【発明の効果】

本発明は、枠状部材に設けた少なくとも接合枠部にはパーフルオロスルホン酸層、パーフルオロスルホニルフルオリド層、パーフルオロカルボン酸アルキルエステル層を有する層を形成し、接合枠部にガス拡散電極を配置して周囲を接合したので、面積が大きなガス拡散電極を作製することに代えて複数個のガス拡散電極を配置することができるので、電極面積が小さな単位ガス拡散電極を用いて電極面積が大きなガス拡散電極を有する電解槽を製造することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は、ガス拡散電極を有するイオン交換膜電解槽の一実施例を説明する図である。

【図2】

図2は、本発明のガス拡散電極を有する電解槽の陰極室をガス拡散電極側の反応層側から見た平面図である。

【図3】

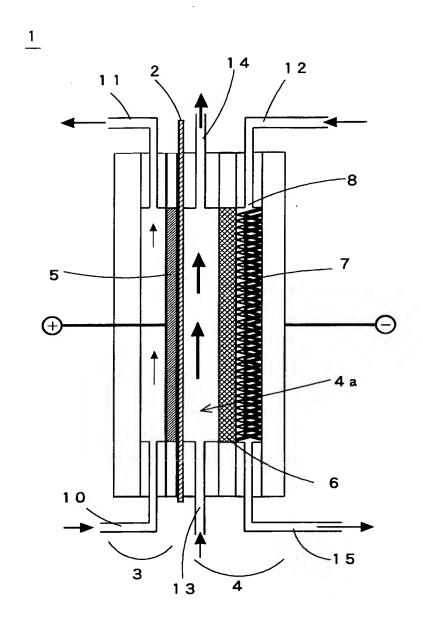
図3は、本発明のガス拡散電極の接合に使用する接合片について説明する図であり、断面を示す図である。

【符号の説明】

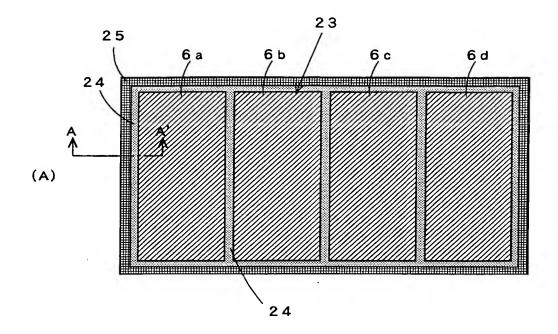
1 …イオン交換膜電解槽、2 …陽イオン交換膜、3 …陽極室、4 …陰極室、4 a …陰極液室、5 …陽極、6 …ガス拡散電極、6 a, 6 b …単位ガス拡散電極、7 …陰極支持体、8 …ガス室、10 …陽極液供給口、11 …陽極液流出口、12 …酸素含有気体供給口、13 …陰極液供給口、14 …陰極液流出口、15 …酸素含有気体排出口、21 …陰極室隔壁、22 …集電体、23 …接合枠部、24 …枠状部材、25 …ガスケット、26 …フランジ面、30 …パーフルオロスルホン酸層、31 …補強布、32 …フッ素樹脂層

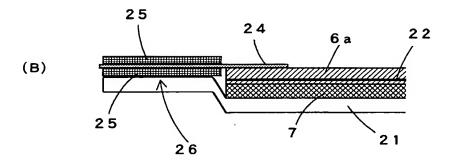
【書類名】 図面

【図1】

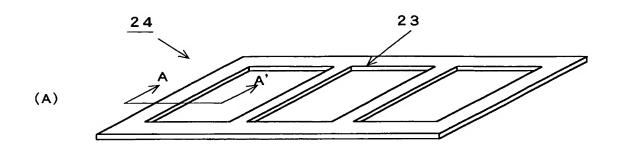


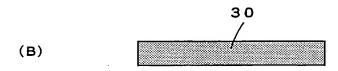
【図2】

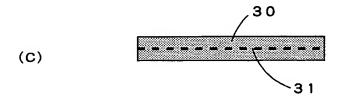


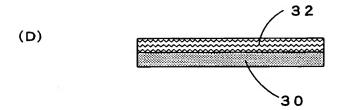


[図3]









【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 多数のガス拡散電極を配置した電極面積が大きなガス拡散電極を有する電解槽を提供する。

【解決手段】 ガス拡散電極を有する電解槽において、ガス拡散電極の対極側に 対向する電極面の周囲が枠状部材に形成された接合枠部と気密に接合され、該枠 状部材の少なくとも接合枠部のガス拡散電極との接合面には、パーフルオロスル ホン酸層、パーフルオロスルホニルフルオリド層、あるいはパーフルオロカルボ ン酸アルキルエステル層を有するとともに、該枠状部材の周辺部はガスケットを 介して積層されたガス拡散電極を有する電解槽。

【選択図】 図2

1/

【書類名】 出願人名義変更届 【整理番号】 CE386 【提出日】 平成15年12月15日 【あて先】 特許庁長官 殿 【事件の表示】 【出願番号】 特願2003-93993 【承継人】 【識別番号】 000005887 【氏名又は名称】 三井化学株式会社 【承継人】 【識別番号】 000003034 【氏名又は名称】 東亞合成株式会社 【承継人】 【識別番号】 000000941 【氏名又は名称】 鐘淵化学工業株式会社 【承継人】 【識別番号】 000003300 【氏名又は名称】 東ソー株式会社 【承継人】 【識別番号】 000000044 【氏名又は名称】 旭硝子株式会社 【承継人】 【識別番号】 00000033 【氏名又は名称】 旭化成株式会社 【承継人】 【識別番号】 000108993 【氏名又は名称】 ダイソー株式会社 【承継人】 【識別番号】 000003182 【氏名又は名称】 株式会社トクヤマ 【承継人代理人】 【識別番号】 100091971 【弁理士】 【氏名又は名称】 米澤 明 【承継人代理人】 【識別番号】 100088041 【弁理士】 【氏名又は名称】 阿部龍吉 【承継人代理人】 【識別番号】 100092495 【弁理士】 【氏名又は名称】 蛭川昌信 【承継人代理人】 【識別番号】 100092509 【弁理士】 【氏名又は名称】 白井博樹 【承継人代理人】

【識別番号】

【氏名又は名称】

【弁理士】

100095120

内田亘彦

【承継人代理人】

【識別番号】 100095980

【弁理士】

【氏名又は名称】 菅井英雄

【承継人代理人】

【識別番号】

100094787

【弁理士】

【氏名又は名称】 青木健二

【承継人代理人】

【識別番号】

100097777

【弁理士】

【氏名又は名称】

韮澤 弘

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 014845 【納付金額】 4,200円

【提出物件の目録】

【物件名】

権利の承継を証明する書面 1

【援用の表示】 特願2003-80067号の出願人名義変更届用として、手続

補足書により平成15年12月15日付で提出のものを援用する

【物件名】

持分譲渡に関する共有者の同意書 1

【援用の表示】 特願2003-80067号の出願人名義変更届用として、手続

補足書により平成15年12月15日付で提出のものを援用する

【物件名】

代理権を証明する書面 8

【援用の表示】 特願2001-046587号の出願人名義変更届用として、手

続補足書により平成15年12月15日付で提出のものを援用す

る。

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-093993

受付番号 50302058477

書類名 出願人名義変更届

担当官 関 浩次 7475

作成日 平成16年 3月11日

<認定情報・付加情報>

【承継人】

【識別番号】 000005887

【住所又は居所】 東京都港区東新橋一丁目5番2号

【氏名又は名称】 三井化学株式会社

【承継人】

【識別番号】 000003034

【住所又は居所】 東京都港区西新橋1丁目14番1号

【氏名又は名称】 東亞合成株式会社

【承継人】

【識別番号】 000000941

【住所又は居所】 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

【氏名又は名称】 鐘淵化学工業株式会社

【承継人】

【識別番号】 000003300

【住所又は居所】 山口県周南市開成町4560番地

【氏名又は名称】 東ソー株式会社

【承継人】

【識別番号】 00000044

【住所又は居所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

【氏名又は名称】 旭硝子株式会社

【承継人】

【識別番号】 00000033

【住所又は居所】 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

【氏名又は名称】 旭化成株式会社

【承継人】

【識別番号】 000108993

【住所又は居所】 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10番8号

【氏名又は名称】 ダイソー株式会社

【承継人】

【識別番号】 000003182

【住所又は居所】 山口県周南市御影町1番1号

【氏名又は名称】 株式会社トクヤマ

【承継人代理人】 申請人

【識別番号】 100091971

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル(7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 米澤 明

【承継人代理人】

【識別番号】 100088041

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル (7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 阿部 龍吉

【承継人代理人】

【識別番号】 100092495

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル(7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 蛭川 昌信

【承継人代理人】

【識別番号】 100092509

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル(7階)梓特許事務所

【氏名又は名称】 白井 博樹

【承継人代理人】

【識別番号】 100095120

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル (7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 内田 亘彦

【承継人代理人】

【識別番号】 100095980

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル (7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 菅井 英雄

【承継人代理人】

【識別番号】 100094787

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル (7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 青木 健二

【承継人代理人】

【識別番号】

100097777

【住所又は居所】

東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル (7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】

韮澤 弘

【書類名】 出願人名義変更届 (一般承継) 【整理番号】 CE386 【提出日】 平成16年 1月22日 特許庁長官 殿 【あて先】 【事件の表示】 【出願番号】 特願2003-93993 【承継人】 【識別番号】 303046314 【氏名又は名称】 旭化成ケミカルズ株式会社 【承継人代理人】 【識別番号】 100091971 【弁理士】 【氏名又は名称】 米澤 明 【選任した代理人】 【識別番号】 100088041 【弁理士】 【氏名又は名称】 阿部龍吉 【選任した代理人】 【識別番号】 100092495 【弁理士】 【氏名又は名称】 蛭川昌信 【選任した代理人】 【識別番号】 100092509 【弁理士】 【氏名又は名称】 白井博樹 【選任した代理人】 【識別番号】 100095120 【弁理士】 【氏名又は名称】 内田亘彦 【選任した代理人】 【識別番号】 100095980 【弁理士】 【氏名又は名称】 菅井英雄 【選任した代理人】 【識別番号】 100094787 【弁理士】 【氏名又は名称】 青木健二 【選任した代理人】 【識別番号】 100097777 【弁理士】 【氏名又は名称】 弘 菲澤 【提出物件の目録】 【物件名】 承継人であることを証明する登記簿謄本 1

【物件名】 権利の承継を証明する書面 1

する。

【援用の表示】

【援用の表示】 特願2001-046587号の出願人名義変更届用として、手 続補足書により平成16年1月22日付で提出のものを援用する

平成3年特許願第046654号の出願人名義変更届用として、手続補正書により平成15年10月17日付で提出のものを援用

【物件名】 【援用の表示】 代理権を証明する書面 1 特願2001-046587号の出願人名義変更届用として、手続補足書により平成16年1月22日付で提出のものを援用する。

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-093993

受付番号 50400105670

書類名 出願人名義変更届 (一般承継)

担当官 関 浩次 7475

作成日 平成16年 3月11日

<認定情報・付加情報>

【承継人】

【識別番号】 303046314

【住所又は居所】 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号

【氏名又は名称】 旭化成ケミカルズ株式会社

【承継人代理人】 申請人

【識別番号】 100091971

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル (7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 米澤 明

【選任した代理人】

【識別番号】 100088041

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル(7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 阿部 龍吉

【選任した代理人】

【識別番号】 100092495

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル(7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 蛭川 昌信

【選任した代理人】

【識別番号】 100092509

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル(7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 白井 博樹

【選任した代理人】

【識別番号】 100095120

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル (7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 内田 亘彦

【選任した代理人】

【識別番号】 100095980

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル (7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 菅井 英雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100094787

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル (7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 青木 健二

【選任した代理人】

【識別番号】 100097777

【住所又は居所】 東京都台東区上野3丁目16番3号 上野鈴木ビ

ル (7階) 梓特許事務所

【氏名又は名称】 韮澤 弘

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000105040]

1. 変更年月日

1992年11月30日

[変更理由]

住所変更

住 所 名

東京都江東区深川2丁目6番11号 富岡橋ビル

クロリンエンジニアズ株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[500509391]

1. 変更年月日

2000年11月 2日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区神田駿河台一丁目5番

氏 名

社団法人新化学発展協会

2. 変更年月日

2003年 9月10日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都千代田区神田須田町一丁目12番

氏 名

社団法人新化学発展協会

出願人履歴情報

識別番号

[000005887]

1. 変更年月日

1997年10月 1日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

氏 名

三井化学株式会社

2. 変更年月日 [変更理由]

2003年11月 4日

更埋田」

住所変更

住 所

東京都港区東新橋一丁目5番2号

氏 名 三井化学株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[000003034]

1. 変更年月日

1994年 7月14日

[変更理由]

名称変更

住 所 氏 名 東京都港区西新橋1丁目14番1号

東亞合成株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[000000941]

1. 変更年月日

1990年 8月27日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市北区中之島3丁目2番4号

氏 名

鐘淵化学工業株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[000003300]

1. 変更年月日

1990年12月 2日

[変更理由]

住所変更

住 所

山口県新南陽市開成町4560番地

氏 名

東ソー株式会社

2. 変更年月日 [変更理由]

2003年 4月21日

住所変更

住 所

山口県周南市開成町4560番地

氏 名

東ソー株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[000000033]

1. 変更年月日

2001年01月04日

[変更理由]

名称変更

住 所

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

氏 名

旭化成株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[000000044]

1. 変更年月日

1999年12月14日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

氏 名

旭硝子株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[303046314]

1. 変更年月日

2003年 8月20日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号

氏 名

旭化成ケミカルズ株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[000108993]

1. 変更年月日

1990年 8月21日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市西区江戸堀1丁目10番8号

氏 名

ダイソー株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[000003182]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

1994年 4月 6日 名称変更 山口県徳山市御影町1番1号

氏 名

出口県徳川市御彭町1番株式会社トクヤマ

2. 変更年月日 [変更理由]

2003年 4月23日 住所変更

住 所 氏 名 山口県周南市御影町1番1号

株式会社トクヤマ